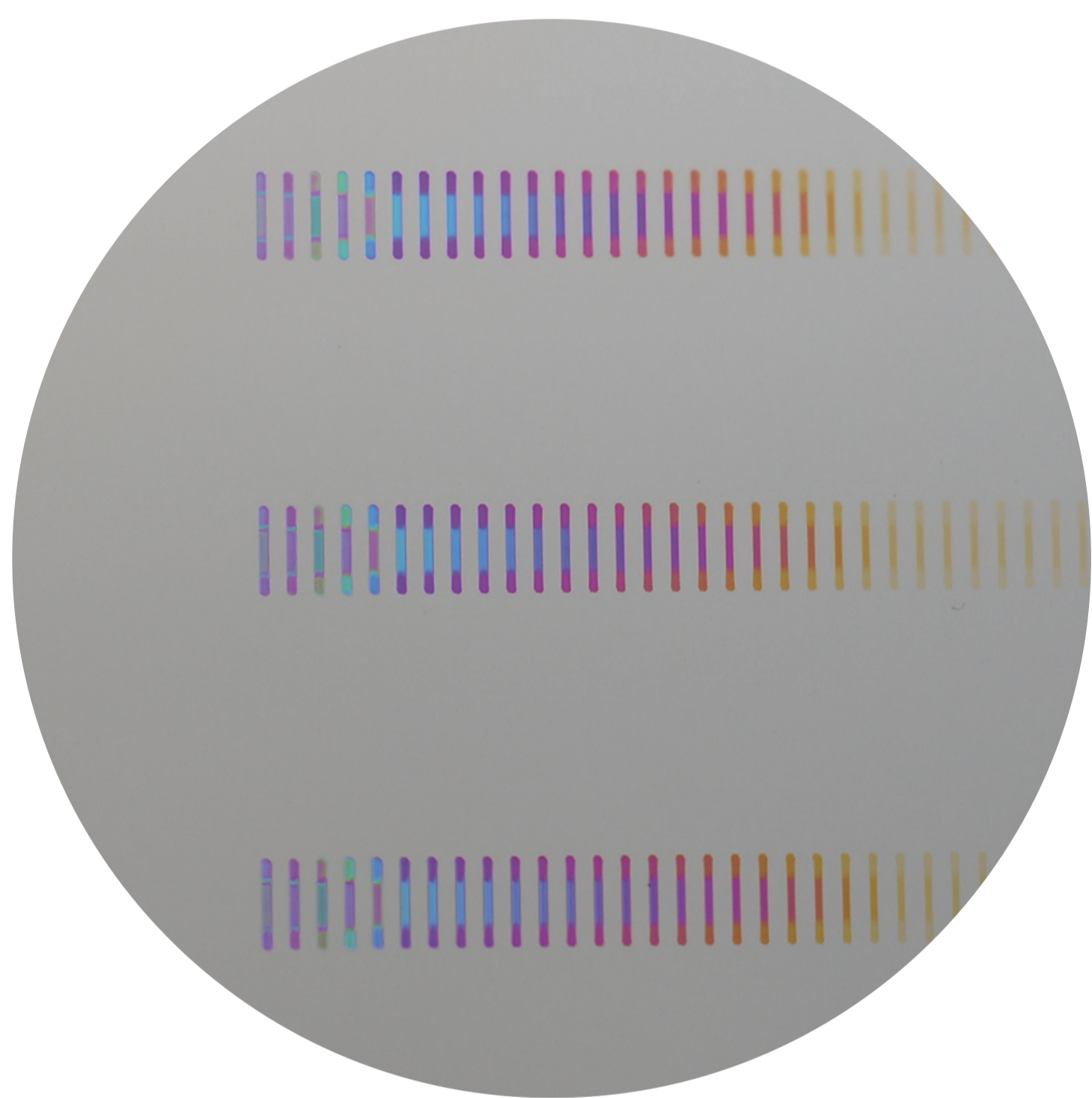


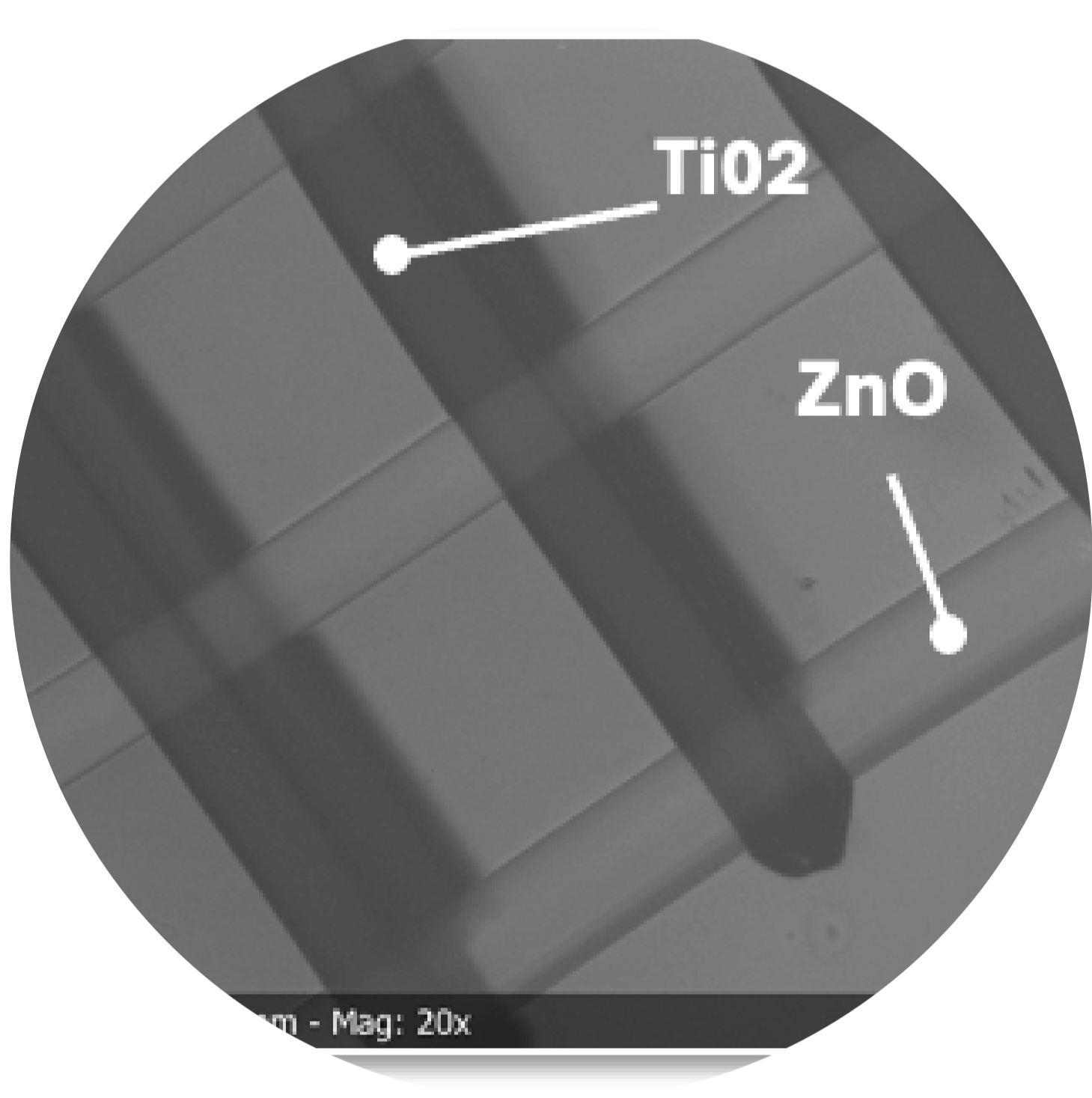
ATLANT 3D 直接原子层打印技术

无掩膜一步式图案化 ALD

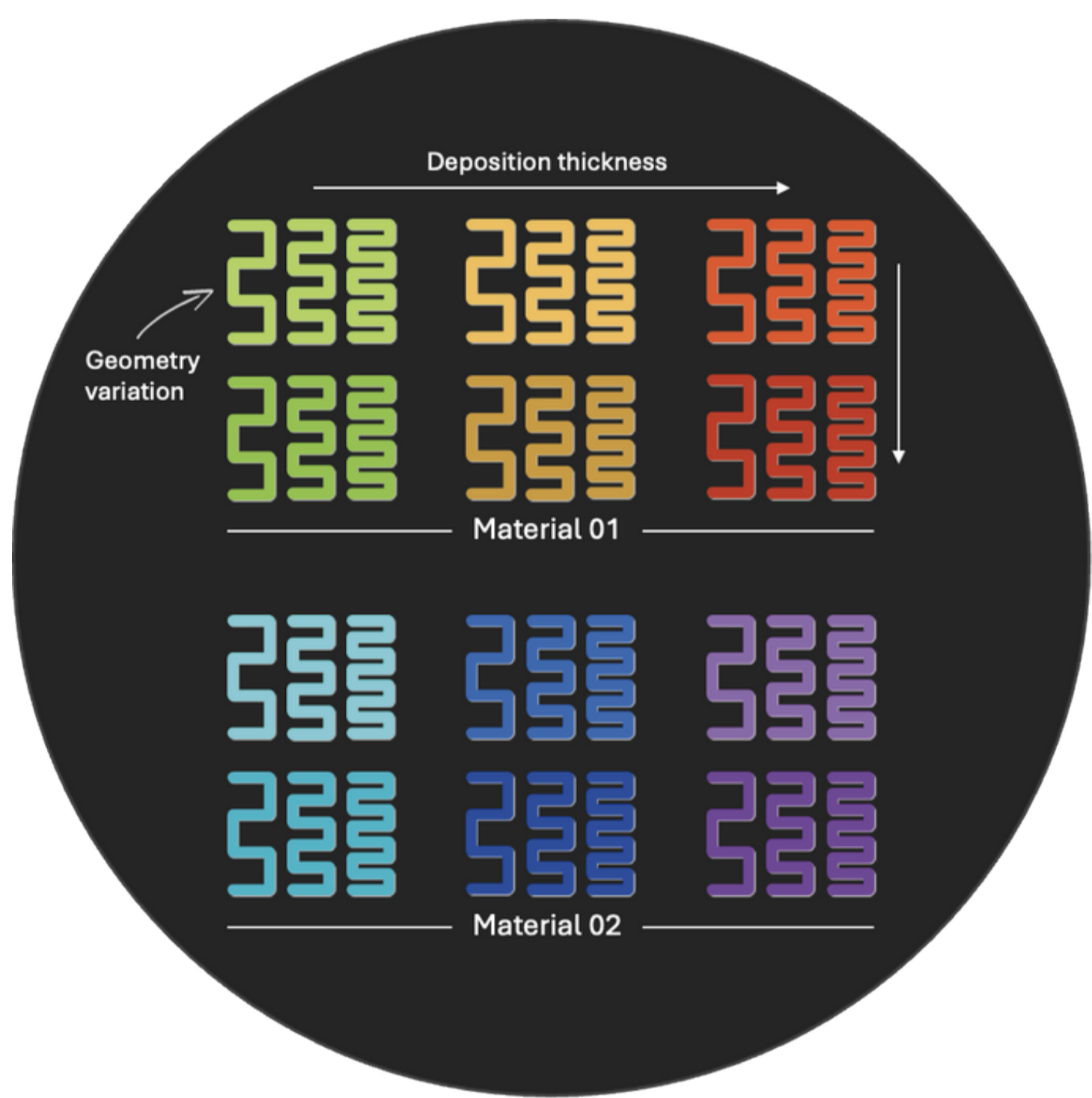
采用独家微化学反应器，将材料精确沉积到所需位置，
一次一个原子层地构建复杂结构
可将其视为“原子级 3D 打印”——
精准、可控，并能制造以往无法实现的结构



ALD梯度厚度涂层打印



多材料堆叠打印



快速实验设计

- 无需掩膜，单步工艺即可逐个原子构建多层结构
- 原子级精准操控，实现 0.3nm 级的精确梯度
- 兼容数百种材料，包括金属、半导体与氧化物
- 复杂形貌掌控，在 90° 直角及深腔等难处理表面获得均匀镀层
- 快速原型制作，迭代周期极短
- 无需洁净室，废料减少 90%，运营成本更低

